# SrTiO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>エピタキシャルバッファー層の導入が MgO 基板上

## (Ba, Sr)TiO3薄膜の電気・光学特性に与える影響

Influence of SrTiO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> epitaxial buffer layer on electrical and optical properties in (Ba, Sr)TiO<sub>3</sub> thin films on MgO substrates

### 名大工<sup>1</sup> <sup>O</sup>(DC)近藤 真矢<sup>1</sup>, 山田 智明<sup>1</sup>, 吉野 正人<sup>1</sup>, 長崎 正雅<sup>1</sup>

Nagoya Univ.<sup>1</sup>, <sup>o</sup>Shinya Kondo<sup>1</sup>, Tomoaki Yamada<sup>1</sup>, Masahito Yoshino<sup>1</sup>, and Takanori Nagasaki<sup>1</sup>

E-mail: t-yamada@energy.nagoya-u.ac.jp

### 【緒言】

MgO は安価で、屈折率が小さく ( $n=1.71@\lambda=1595.2$  nm) [1]、誘電率と誘電損失も小さいこと から、強誘電体薄膜を用いた光変調デバイスや高周波チューナブルデバイスに適した基板として 期待されてきた。しかし、 (Pb, Zr)TiO<sub>3</sub> や(Ba, Sr)TiO<sub>3</sub> (BST) などの代表的なペロブスカイト型強 誘電体に対して格子ミスマッチが大きく、結晶構造も異なることから、平滑で高い結晶性の薄膜 を作製することは一般に困難である。本研究では、1 ML の TiO<sub>2</sub> と 10 nm の SrTiO<sub>3</sub> (STO) から なる STO /TiO<sub>2</sub> エピタキシャルバッファー層を導入することで、SrRuO<sub>3</sub> (SRO)下部電極及び BST 強誘電体層の成長モードを変化させ、薄膜表面の平滑性と結晶性を大幅に向上させることに成功 した。この STO /TiO<sub>2</sub> バッファー層導入による結晶性の違いが、BST 薄膜の電気・光学特性に及 ぼす影響を評価した。

#### 【実験方法】

パルスレーザー堆積法を用いて、MgO(001)単結晶基板上に1ML-TiO2を基板温度 600 ℃、酸素 分圧 0.5 mTorr で堆積し、さらに基板温度を 750 ℃ にして STO を 10 nm 堆積した。次に、基板温 度を 700 ℃ にして、下部電極である SRO を 200 mTorr O2 で 50 nm、最後に BST を 10 mTorr O2 で 270 nm 堆積した。比較として、同条件でバッファー層を導入せずに BST/SRO/MgO 構造を作製し た。上部電極としては直径 100 µm、厚さ 50 nm の白金層を電子ビーム蒸着法で作製した。薄膜の 結晶構造や配向性の評価は X 線回折 (XRD)、表面状態の評価には、原子間力顕微鏡 (AFM) と 反射高速電子線回折 (RHEED)、電気特性の評価には LCR メーターと強誘電体テスタを用いた。 また、電気光学 (EO) 特性の評価には温度制御可能な電界変調型のエリプソメーターを使用した。

#### 【実験結果 [2]】

Fig. 1 に STO /TiO<sub>2</sub> バッファー層(1)無しと(2)有りの SRO 及び BST 薄膜の RHEED 像を示す。(1) では SRO、BST ともにぼやけたスポット状のパターンが観測された。一方、(2)の方は明瞭なスト リーク状のパターンが観測された。XRD や AFM の測定結果と合わせて、(1)では低い結晶性で 3 次元的に成長したが、(2)では高い結晶性を有して 2 次元的に成長し、平滑な平面が形成されるこ とが分かった。Fig. 2 に両薄膜の誘電特性の温度依存性を示す。バッファー層を用いることで、BST の結晶性が向上し、誘電率が向上することが明らかになった。さらにエピタキシャル歪みに よって、相転移温度が高温側にシフトした。当日は EO 特性についても報告する予定である。



Fig. 1. RHEED patterns of SRO layers (1) and BST films (2) deposited on MgO :(a) without and (b) with a STO/TiO2 buffer layer (BL).



Fig. 2. Temperature dependences of  $\varepsilon_r$  and tan $\delta$  for the BST films with and without a BL.

### 【参考文献】

- [1] R. E. Stephens and I. H. Malitson, J. Res. Natl. Bur. Stand. 49, 249 (1952).
- [2] S. Kondo et al., Jpn. J. Appl. Phys. 57, 0902B1 (2018).